008950022/7

008950022 WPI Acc No: 92-077291/10

XRAM Acc No: C92-035896

Spirooxazine photochromic materials - with good durability for repeated colour development and disappearance, used for dimming materials, photosensitive materials, etc.

Patent Assignee: (ASAG ) ASAHI GLASS KK

Number of Patents: 001 Number of Countries: 001

Patent Family:

CC Number Kind Date Week

JP 4023885 A 920128 9210 (Basic)

Priority Data (CC No Date): JP 90126827 (900518)

Abstract (Basic): JP 4023885

Material of formula (I) is new. In (I) Rf = polyfluoroalkyl, fluoroalkyl or F; R1-6 = H, 1-25C hydrocarbon or hydrocarbon with alkoxy, halogen such as F, Cl, Br or I, ester, cyano, nitro, ether, thioether, carbonyl, sulphonyl, opt. substd. amino, imino, amido, thioamido, urethane, urea, isocyanato, azo or hydroxy, thiol, carboxy or sulpho or their metal salts; R2 and R3 can bond with each other to cyclise; A = a carbocyclic or heterocyclic aromatic ring opt. substd; and X = C or N.

USE/ADVANTAGE - The photochromic cpds. have an absorption peak at 650-670 nm when colour-developed. They have good durability for repeated colour development and disappearance and are useful as dimming materials for window glass, curtains, sunglasses and ski goggles, printing photosensitive materials for reusable paper, copying, recording, memory, display, optical filter, masking, actinometer, paint, clothes, toy, sporting good, cosmetic and ornamental materials and photosensitive materials for laser and holography. @(5pp Dwg.No.0/0)@

Derwent Class: A60; D21; E13; G06; E23; Int Pat Class: C07D-498/10; C09K-009/02

? t 008950021/7

19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-23885

Int. Cl. 5

7

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 4年(1992) 1月28日

C 09 K 9/02 C 07 D 498/10 498/20

B 8930-4H S 8415-4C 8415-4C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

**夕**発明の名称 フォトクロミツク材料

②符 願 平2-126827

雄

隆

②出 願 平2(1990)5月18日

⑫発 明 者 松 尾

仁 神奈川県横浜市緑区荏田南1-20

⑫ 発明 者 須 賀 淳

神奈川県横浜市神奈川区菅田町138

砲発 明 者 宮 島

神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町528

切出 願 人 旭硝子株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

⑫代 理 人 弁理士 内 田 明 外2名

#### 明 細 書

1. 発明の名称

フォトクロミック材料

2. 特許請求の範囲

一般式(a)

(式中、R・はポリフルオロアルキル基またはフッ素原子を示す。R・、R・、R・、R・、R・、R・は水素原子・は水素原子・皮素数1~25の皮化水素基、あるいはアルコキシ基、F・またはC1、Br、I等のハロゲット・エステル基、シアノ基、ニトロ基、エーテル基、カルボニル基、スルホニル基、アミノ基、置換アミノ基、イミノ基、アミド基、ウレタン基、ウレア基、チオアミド基、ウレタン基、ウレア

ソシアネート基、アゾ基、またはヒドロキシ基、 チオール基、カルボキシル基、スルホン酸基お よびその金属塩基を有する炭化水素基を示す。 R・、R・、R・、R・、R・はそれぞれ 同一もしくは異なる電換基であり、R・、R・は 互いに結合し環化していてもよい。環Aは電換されていてもよい炭化水素芳香環または痩素環系芳 香環を示す。 X は炭素または 窒素を示す。)で 表されるスピロオキサジン系フォトクロミック 材料。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は窓用調光ガラス、カーテン、サングラス、スキー用ゴーグル等の調光材料、再生使用可能なコピー用紙等の印写用感光材料、複写材料、または各種の記録・記憶材料、表示材料、レーザー用感光材料、ホログラフィー用感光材料、あるいは光学フィルター、マスキング用材料、光量計、ディスプレー用材料、または塗料、表料、玩具、スポーツ用品、化粧品、装飾品用材料として

有用な新規フォトクロミック材料に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

6

フォトクロミック化合物は数多く知られており、代表的なものにスピロピラン化合物がある。 (G. H. Brown, "Photochromism", Interscience, New York (1971))

またスピロオキサジン化合物が紫外光により発色: 熟または可視光により消色するフォトクロミック性を有することは知られている。

例えば、特公昭45-28892 号、特公昭49-8631号、特開昭55-36284号、特開昭61-53288号、特開昭61-263982号、特開昭62-33184号、USP4342668にはスピロナフトオキサジン系化合物の置換誘導体および該化合物を含有するフォトクロミック材料が提案されている。

また、特開昭 60 - 53 58 6号、特開昭 62 - 28 8 6 8 2 号にはペンゼン環、ナフタレン環にトリフルオロメチル基を有するスピロナフトオキサジン系化合物を用いたフォトクロミック材料が開示され

ルオロアルキル番またはフッ素原子を導入した新 規スピロオキサジン系化合物を含有することによ り上記の問題点を解決するものである。

$$\begin{array}{c|c}
R^2 R^3 R^4 \\
N \\
0 \\
R^1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
R_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^6 \\
R^5
\end{array}$$

ている.

また、特開昭 50-1128 80 号、特開昭 52-153 192 号にはスピコピリドベンゾオキサジン系化合物および該化合物を用いたフォトクロミック材料が提案されている。

また、特開昭 52-164685 号、特開昭 53-30489号にはスピロフェナンスロオキサジン系化合物および該化合物を使用した感光材料が提案されている。

# [発明が解決しようとする問題点]

スピロピラン化合物は光発消色の繰り返し耐久性に問題があった。またスピロオキサジン化合物は繰り返し耐久性に関しては前記化合物に比べて向上しており、また種々の置換誘導体が知られているが色調の多様性に欠けていた。

### [問題点を解決するための手段]

本発明は前記問題点を解決するための新規フォトクロミック材料に関するものである。本発明のフォトクロミック材料は下記の一般式 (a) で表される R, にポリフロオロアルキル基、またはフ

R・、R・、R・、R・、R・はそれぞれ 同一もしくは異なる置換基であり、R・、R・は 互いに結合し現化していてもよい。環Aは置換さ れていてもよい炭化水素芳香環または複素環系芳 香環を示す。Xは炭素または窒素を示す。)

上記式(a)において、R,で表されるポリフルオロアルキル基としては、エーテル結合を有していてもよい直鎖状、分岐状、または環状ベルフルオロアルキル基、または下記の一般式(b)

(式中、YはH、Cl、Br、I、COOH等を示し、R、は、エーテル結合を有していてもよい直貫状、分岐状、または環状ベルフルオロアルキレン基)等を挙げることが出来る。好ましくは炭素数1~10の直貫状ベルフルオロアルキル基であり、特にトリフルオロメチル基が好ましい。

また上記式(a)で表される化合物において理 Aの置換されていてもよい炭化水素芳香環または 複素環系芳香環としては、ペンゼン環、ナフタレ ン環、キノリン環、フェナンスレン環、アントラ

セン環、ビリジン理等が挙げられる。好ましくは、 没Aはペンゼン技、ピリジン環である。これらの 置換基としてはトリフルオロメチル基、ポリフル オコアルキル基、フルオロアルキル基、Fまたは C1、Br、I等のハロゲン原子、エステル基、 シアノ基、ニトロ基、ニーテル基、チオエーテル 基、カルボニル基、スルホニル基、アミノ基、置 換アミノ基、イミノ基、アミド基、チオアミド 基、ウレタン基、ウレア基、イソシアネート基、 アゾ基、またはヒドロキシ基、チオール基、カル ポキシル基、スルホン酸基およびその金属塩基、 炭素数1~25の炭化水素基、あるいはアルコキシ 基、F、またはCI、Br、I等のハロゲン原 子、エステル基、シアノ基、ニトロ基、エーテル 基、チオエーテル基、カルボニル基、スルホニル 基、アミノ基、置換アミノ基、イミノ基、アミド 基、チオアミド基 ウレタン基、ウレア基、イソ シアネート基、アゾ基、またはヒドロキシ基、チ オール基、カルポキシル基、スルホン酸基および その金属塩基を有する炭化水素基等が挙げられ

る。 X は炭素または窒素である。また R 1 、 R 2 に で は、 アルキル基、 アルキレン 量等を介してもう一つのスピロオキサジン理と結合し、全体として 2 量体の化合物を形成したものも挙げられる。また R 1 、 R 1 、 R 2 、 A 7週に 二重結合、 シランカップリング 基等の 反応性基を導入し、 マトリックス材料と結合させることも主味る。

本発明の新規フォトクロミック材料は光発消色の繰り返し耐久性に優れ、一般式(a)のR。にポリフルオロアルキル基またはフルオロアルキル基またはフッ素原子を導入することにより発色時の吸収極大が650na ~670na であるという特徴を有する。

本発明の化合物は、例えば次のようにして製造 することが出来る。下記一般式 (c)

(式中、R<sup>\*</sup>、R<sup>\*</sup>、Xは前記定義と同じ。)で表されるヒドロキシアミノ誘導体をNaNO。 とKIにてジアゾよう素化することにより下記 一般式(d)

(式中、R°、R°、Xは前記定程と同じ。)で表されるヒドロキショード誘導体を得た。これを下記一般式(e)

(R. は前記定義に同じ。) で表されるポリフルオロ、またはフルオロアルキルアイオダイドとを 銅粉の存在下反応させ、下記一般式 (f)

$$HO \bigvee_{R^e} \stackrel{R_i}{\bigvee_{r}} R^e \qquad (r)$$

(式中、R,、R°、R°及びXは前記定義と同じ。)で表される含R,とドロキシ誘導体を得た。またR,がフッ素原子のものは一般式(C)で表されるヒドロキシアミノ誘導体をNaNO。 とBF:・HFにてジアゾフッ素化することにより得た。続いてNaNO。にてニトロソ化することにより下記一般式(g)

(式中、Rr、Rr、Rr及びXは前記定義と同じ。)で表されるニトロソーヒドロキシ誘導体を得た。これを下記一般式(h)

(式中、R1、R1、R1、R1及び環Aは前記) 定義に同じ。)で表されるインドリン誘導体と選 基の存在化反応させることによって製造出来る。

ヒドロキショード誘導体のポリフルオロアルキル化反応は開份の存在下無溶膜あるいは溶媒中、 0 で~200 での反応温度で実施される。好ましく は D M S O 、 D M A c 、 D M F 等の非プロトン性極性溶媒中にで 50で~150 でで円滑に実施出来る。

またインドリン誘導体とニトロソーヒドロキシ 誘導体のカップリング反応はトリエチルアミン、 ピペリジン、ピペラジン、モルホリン等の塩基の 存在下無溶緩あるいは溶媒中、0℃~ 150℃の反 応温度で1時間~8時間反応することにより実施 される。好ましくはトルエン、エタノール中、ト リエチルアミンの存在下、40℃~ 120℃で円滑に 実施出来る。

本発明のフォトクロミック材料のマトリックス 材料としては、ガラス、光学的に透明な樹脂、例 えばポリビニルブチラール、ポリビニルアルコー

マトリックス材料への本発明フォトクロミック化合物の配合方法としては染色法、キャスティング法、配合されたポリマー溶液のコーティング法、または本発明フォトクロミック化合物をマイクロカブセル化した後に付着する方法、あるいは本発明フォトクロミック化合物中の二重結合、シランカップリング基等の反応性基とマトリックス材料を反応させることにより結合する方法等、各種の方法が適用出来る。

また、本発明のフォトクロミック材料においては、耐光性向上のために紫外線吸収剤、酸化防止

剤、ヒンダードアミン系安定剤等を添加すること も出来る。

#### [実施例1]

#### - 合成例 1 -

8-トリフルオロメチル-2-ナフトールの合成8-ヨード-2-ナフトール16gを DMAc 400 alに溶解し、トリフルオロ酢酸ナトリウム 27gとよう化第一瞬19gを加え、160 でにて 4 時間撹拌した。抽出処理の後、有機溶媒を減圧にて留去し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて分離精製し、表記の化合物を 7g得た。

'HNMR (CD, Cl) : δ 5.8 ppm (bs, lH), 7.1 ~ 8.0 ppm (m, 6 H)

1\*FNMR (CD, Cl, CFCl, 基準): δ

#### - 合成例 2 -

- 61 pps (3 F)

1.3.3-トリメチル-10°-トリフルオロメチル-スピロ [インドリン-2.3°-(3H)- ナフト (2.1-b) (1.4) オキサジン] の合成

'H N M R (C D , C 1) : δ 1.4 ppm (s, 6 H), 2.8 ppm (s, 3 H), 6.5 ~ 8.5 ppm (m, 1 O H)

\*\*FNMR (CD, C1, CFC1, 基億) : δ
— 61 ppm (3 F)

#### 【実施例2】

1.3.3-トリメチル - 10'-ベンタフルオロエチル - スピロ {インドリン-2.3'-(3H)- ナフト(2.1 -b) (1.4) オキサジン} の合成

トリフルオロ酢酸ナトリウムの代わりにベンタフルオロエチルアイオダイドを、よう化第一個の代わりに関粉を用いて実施例1と同様の手法にて表記化合物を合成した。

'HNMR (CD, C1): δ 1.3 ppm (s. 6H), 2.8 ppm (s. 3H), 6.5 ~ 8.5 ppm (m. 1OH)

'\*FNMR (CD, C1, CFC1, 基值): δ --82 ppm (3F), --120 ppm (2F)

#### [実施例3]

1.3.3-トリメチル - 10'-パーフルオロブチルースピロ (インドリン-2.3'-(3H)- ナフト(2.1-b)(1.4) オキサジン の合成

トリフルオロ酢酸ナトリウムの代わりにパーフルオロブチルアイオダイドを、よう化第一銅の代わりに飼粉を用いて実施例1と同様の手法にて表

M C P D - 1000を用いて20℃にて行った。

表 1

No.	構 造	吸収極大	色鋼
実施例 1	CF3	650 (nm)	12
寒 施 例 2	C <sub>2</sub> F <sub>5</sub>	660 (nm)	#
実施例3	C <sub>q</sub> F <sub>q</sub>	670 (nm)	₽.
比較例		605 (nm)	#

記化合物を合成した.

'HNMR (CD, Cl): δ 1.3 ppm (s. 6 H). 2.8 ppm (s. 3 H). 5.5 ~ 8.5 ppm (m. 10 H)

''FNMR (CD, C1, CFC1, 基準): 5
- 81 ppm (3F), - !!! ppm (2F),
- 123 ppm (2F), - 125 ppm (2F)

#### [試験例]

ポリピニルブチラールの30%トルエン:イソブロピルアルコール (42:58) 混合溶液にスピロオキサジン化合物のトルエン溶液を加え (スピロオキサジン化合物/ポリピニルブチラール=0.15mool/g) 撹拌した。この溶液からキャスト製態し約50μの厚さのフィルムを得た。室温にて 2 時間風乾、40℃にて 1 時間乾燥後スペクトルを測定した。結果を表 1 に示す。

測定用励起光源としてキセノンランプを、 繁外 観透過フィルターとして H O Y A 製ガラスフィルター U 3 6 0 を用いた。吸収波長、吸光度の測 定には、 大塚電子製練間マルチ測光システム

## [発明の効果]

本発明の新規フォトクロミック材料は光発消色の繰り返し耐久性に優れ、発色時の吸収極大が650na~670naという特徴を有する。

このような本フォトクロミック材料は窓用買光ガラス、カーテン、サングラス、スキー用ゴーグル等の顕光材料、再生使用可能なコピー用紙造りでは材料、複写材料、または各種の記録・記憶材料、表示材料、レーザー用感光材料、ホログラフィー用感光材料、あるいは光学フィルター、マスキング用材料、光量計、ディスプレー用材料、または衣料、装飾品用材料として使用される。

代章人内 田 死 明 一 表 明 一 夫 明 二 夫